(19) 日本国特許庁 (JP)

四公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平7-288332

(43) 公開日 平成 7年 (1995)10 月 31日

(51)Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FI				技術表示箇例
HO1L 31/02	232						
21/56	J						
23/28	B D	8617 — 4 M					
				HO1L	31/02	D	
					31/10	A	
審査請	求 未請求 請求	項の数 5	O L			(全 9 頁)	最終頁に続く
(21) 出願番号	特願平6-255457			(71) 出願人	000005223		
				(II) MARKY	富士通株式		
(22) 出願日	平成 6年(1994)10	6年(1994)10 月20日			神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地		
			ļ	(72) 発明者			TIOIDEAS
(31) 優先権主張番号 特願平6-27066						川崎市中原区上小田	中1015番地
(32) 優先日 平6(1994)2月25日					富士通株式		
(33) 優先権主張国	日本 (JP)			(72) 発明者	石山 貴	Ż	
					神奈川県川	川崎市中原区上小田	中1015番地
					富士通株式		
				(72) 発明者	渡辺 弘	=	
					神奈川県川	川崎市中原区上小田	中1015番地
					富士通株式	式会社内	,
				(74) 代理人	弁理士	井桁 貞一	
							最終頁に続く

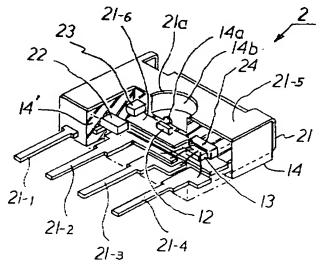
(54)【発明の名称】光素子組立体とその製造方法

(57)【要約】

【目的】 光素子と I C チップとを持つ光素子組立体に関し、ノイズ抑制と確実なシールドを安価に実現して生産性向上を図ることを目的とする。

【構成】 外部接続端子を具えたリードフレームのデバイス搭載域に少なくとも光素子とその近傍に配置される I C チップとを実装した状態で、該光素子への光信号入 出路が少なくとも透明になるように該デバイス搭載域の 周囲を外部接続端子域を除いて樹脂封止してなる光素子組立体であって、樹脂封止される前の上記 I C チップ 13 の表面が光不透過性樹脂24で被覆されていると共に、樹脂封止後の上記デバイス搭載域の上記光信号入出路を除く全周囲を前記リードフレーム21の接地用の外部接続端子に繋がるシールド片21-5で被覆して構成する。

本発明になる光素子組立体の構成を観略的に説明する図



2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 外部接続端子を具えたリードフレームのデバイス搭載域に少なくとも光素子とその近傍に配置されるICチップとを実装した状態で、該光素子への光信号入出路が少なくとも透明になるように該デバイス搭載域の周囲を外部接続端子域を除いて樹脂封止してなる光素子組立体であって、

樹脂封止される前の上記ICチップの表面が光不透過性 樹脂で被覆されていると共に、樹脂封止後の上記デバイス搭載域の上記光信号入出路を除く全周囲が前記リード フレームの接地用の外部接続端子に繋がるシールド片で 被覆されていることを特徴とする光素子組立体。

【請求項2】 請求項1記載の外部接続端子域を除く周囲を封止する樹脂が、前記シールド片を内在させるように成形されていることを特徴とする光素子組立体。

【請求項3】 請求項1記載の光素子組立体の製造方法であって、

箱形に折り込んだときに上記光素子への光信号入出路を除く周囲が覆い得るような展開外形と大きさを持つシールド片が接地用の外部接続端子に繋がった状態で形成されているリードフレームの上記デバイス搭載域に、上記光素子とICチップとを含むデバイスを実装する工程と、

実装された該 I Cチップの表面を光不透過性樹脂で被覆する工程と、

該リードフレームの外部接続端子域を除くデバイス搭載 域を、実装されたデバイスと共に透明な樹脂で樹脂對止 して透明樹脂体を形成する工程と、

上記シールド片の該透明樹脂体外面に沿う折り込みで、 該透明樹脂体の周囲を被覆する工程、

とを含むことを特徴とする光素子組立体の製造方法。

【請求項4】 請求項3記載の光素子組立体の製造方法 に、

前配シールド片の光素子への光信号入出路を除く全周囲 を覆う樹脂成形工程、

を含めることを特徴とする光素子組立体の製造方法。

【請求項5】 請求項1記載の光素子組立体の製造方法であって、

箱形に折り込んだときに上記光素子への光信号入出路を除く周囲が覆い得るような展開外形と大きさを持つシールド片が接地用の外部接続端子に繋がった状態で形成されているリードフレームの上記デバイス搭載域に、上記 光素子とICチップとを含むデバイスを実装する工程と、

実装された該ICチップの表面を光不透過性樹脂で被覆する工程と、

上記シールド片を、そのデバイス搭載域が実装されたデバイスと共に内在するように折り込んで箱形に形成する 工程と、

上記リードフレームの外部接続端子域を除くデバイス搭

載域を、箱形に形成された上記シールド片が内在し得る ように上記デバイスと共に透明な樹脂で樹脂封止する工 程。

とを含むことを特徴とする光素子組立体の製造方法。 【発明の鮮細な影明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は光信号を電気信号に変換しまたは電気信号を光信号に変換する光関連装置(以下文中では光素子組立体とする)に係り、特に光素子と組か合わせてその近傍に配置される信号変換用ICへの光信号の影響をなくして光素子組立体としてのノイズ発生を抑制すると共に、特別なシールド部材を準備することなく光素子への光信号入出路領域を除く全周囲を確実にシールドして特性的に安定させた光素子組立体とその製造方法に関する。

【0002】最近の電子機器分野では遺り取りする情報 量の増加に伴って各装置間を繋ぐ信号線に光ケーブルを 使用する場合が多くなっているが、光ケーブルを通して 送られてくる光信号を電気信号に変換しまたは電気信号 20 を光ケーブルに送り込む光信号に変換するには、少なく とも光素子と信号変換用 I Cとを具えた光素子組立体を 光ケーブルと電子装置間に介在させる必要がある。 【0003】

【従来の技術】図10は従来の光素子組立体の構成を製造 方法と共に説明する概略図であり、(10-1)は構成を示す 断面図(10-2)は内部の回路構成を示した図である。

【0004】なお図では受信用光素子組立体の場合を例 として説明する。図10の(10-1),(10-2)で受信用の光素 子組立体1は、個々に分離した4本の外部接続端子1

30 1-1, 11-2, 11-3, 11-4を持つリードフレーム11と、外部接続端子11-1の所定域に搭載されているピン・フォトダイオードの如き受光素子12、外部接続端子11-2の所定域に搭載されているピン・フォトダイオードの如き受光素子12、外部接続端子11-2の所定域に搭載されている信号変換用の I C チップ13、各外部接続端子11-1、11-2, 11-3, 11-4の先端のみが露出するように例えば破線Aで示す範囲の如く該受光素子12と I C チップ13とをリードフレーム11の搭載域と共に角形ブロック状に封止する透明樹脂14′、該透明樹脂14′で対止された角形の透明樹脂4′、該透明樹脂14′で対止された角形の透明樹脂44の受光素子搭載面側を除く全周囲を覆う電磁波シールド部材15、および該受光素子40 搭載面側の受光素子12と対応する領域に設けた孔状の光ファイバ挿入部16a を除く全周囲を覆う光不透過形樹脂16′からなるモールド体16とで構成されている。

【0005】そしてこの場合の該光素子組立体1は、先ず上記リードフレーム11の外部接続端子11₋₁の所定域に受光素子12を導電ペースト等で固定しまた接地端子となる外部接続端子11₋₂の所定域にICチップ13を同様の手段で固定する。

【0006】次いで、受光素子12の電源電極を電源端子 となる外部接続端子11_4にまた出力電極を I Cチップ13 50 にそれぞれ接続すると共に、 I Cチップ13の残り2個の 3

各電極を出力端子となる外部接続端子11_3と外部接続端 子11_4とに接続する。

【0007】その後、該リードフレーム||の上述した破線域Aを受光素子|2・I Cチップ|3と共に透明樹脂|4′で角形ブロック状に対止被覆して透明樹脂体|4を形成し、続いてその表面所要域を例えばネサ膜からなる電磁波シールド部材||5で覆いそれを接地端子となる上記外部接続端子||1-2に短絡せしめる。

【0008】更に、受光素子12と対応する領域に図示されない光ファイバを挿入するための光ファイバ挿入部16 a が凹孔として形成されるように、上記領域Aを光不透過形樹脂16′で角形に封止してモールド体16を形成して図示の光素子組立体1を構成するようにしている。

【0009】なお、該透明樹脂体14の受光素子12と対応 する光ファイバ挿入部16a に形成されている半球状凸レ ンズ14a は図示されない光ファイバからの光信号を受光 素子12に集光させるものである。

【0010】かかる光素子組立体1では、受光素子12に入射する光信号がICチップ13で変換されて出力側の外部接続端子11-aから出力されるので、該外部接続端子11-aに繋がる電子装置に所要の電気信号を送達することができる。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】しかしかかる光素子組立体1では、近接して位置する光素子12と1 Cチップ13が共に透明樹脂14、で被覆されているため光素子12に入射する光信号の一部が1 Cチップ13を照射しそれを構成するトランジスタ等に作用してノイズを発生させることがあると言う問題があり、また電磁波シールド部材15の形成に特別な成膜工程が必要なることから工数が掛かって生産性の向上を期待することができないと言う問題があった。

[0012]

【課題を解決するための手段】上記課題は、外部接続端子を具えたリードフレームのデパイス搭載域に少なくとも光素子とその近傍に配置されるICチップとを実装した状態で、該光素子への光信号入出路が少なくとも透明になるように該デパイス搭載域の周囲を外部接続端子域を除いて樹脂針止してなる光素子組立体であって、樹脂封止される前の上記ICチップの表面が光不透過性樹脂で被覆されていると共に、樹脂封止後の上記デパイス搭載域の上記光信号入出路を除く全周囲が前記リードフレームの接地用の外部接続端子に繋がるシールド片で被覆されている光素子組立体によって解決される。

【0013】また、外部接続端子を具えたリードフレームのデバイス搭載域に少なくとも光素子とその近傍に配置されるICチップとを実装した状態で、該光素子への光信号入出路が少なくとも透明になるように該デバイス搭載域の周囲を外部接続端子域を除いて樹脂針止してなる光素子組立体の製造方法であって、箱形に折り込んだ

ときに上記光楽子への光信号入出路を除く周囲が覆い得るような展開外形と大きさを持つシールド片が接地用の外部接続端子に繋がった状態で形成されているリードフレームの上記デバイス搭載域に、上記光素子とICチップとを含むデバイス搭載域に、上記光素子とICチップとを含むデバイスを実装する工程と、実装された該ICチップの表面を光不透過性樹脂で被覆する工程と、該リードフレームの外部接続端子域を除くデバイス搭載域を、実装されたデバイスと共に透明な樹脂で樹脂對止して透明樹脂体を形成する工程と、上記シールド片の該透明樹脂体外面に沿う折り込みで、該透明樹脂体の周囲を被覆する工程、とを含む光素子組立体の製造方法によって解決される。

[0014]

【作用】ICチップの表面を光不透過性樹脂で覆うと光信号照射によるICチップとしてのノイズ発生を抑制することができる。

【0015】またリードフレームは金属板で形成されるものであるため、該リードフレームの一部をシールド板としてデバイス周囲を覆うことで光素子組立体としての電磁シールドを実現することができる。

【0016】そこで本発明では、リードフレームの光素子やICチップ等を実装する領域(以下文中ではデバイス実装域とする)の周囲が折り曲げ成形でカバーし得るような展開形状と大きさを持つシールド片が備えられたリードフレームを使用し、該リードフレームのデバイス実装域に実装されたICチップ表面を光不透過性樹脂で覆った後、図10同様の透明樹脂による成形工程で光素子組立半完成体を形成し、しかる後の上記シールド片の折り曲げで該光素子組立半完成体をカバーすることで、光30素子組立体としてのノイズ発生の抑制と確実な電磁シールドとを実現するようにしている。

【0017】従って、ノイズ抑制と特別なシールド部材なしの確実な電磁シールドとが共に実現できる光素子組立体を容易に構成することができる。

[0018]

【実施例】図1は本発明になる光素子組立体の構成を概略的に説明する図であり、図2は図1に示す実施例の製造工程説明図(その1)、図3は図1に示す実施例の製造工程説明図(その2)、図4は図1に示す実施例の製造工程説明図(その3)である。

【0019】また図5は光素子組立体の他の構成例を説明する図、図6は光素子組立体の第3の構成例を説明する図、図7は光素子組立体の他の製造方法を工程的に説明する図(その1)、図8は光素子組立体の他の製造方法を工程的に説明する図(その2)、図9は光素子組立体の他の製造方法を工程的に説明する図(その3)である。

【0020】なお図ではいずれも、図10の光素子組立体 で外付けとしたコンデンサを内蔵させた場合を例として 50 いるので、リードフレームのデバイス実装域での回路構

4

成は図10と異なっているが、機能的には図10の光素子組 立体に対応させているので図10と同じ対象部材・部位に は同一の記号を付して表わしていると共に重複する説明 についてはそれを省略する。

【0021】図1で本発明になる受信用としての光素子 組立体2は、個々に分離した4本の外部接続端子21_1. 21-2, 21-3, 21-4と、その内のアナログ信号接地用の外 部接続端子21_1に続くシールド片21_5、該各外部接続端 子21-1~21-3の内側にそれぞれ独立して位置する光素子 搭載ステージ21₋₆、図示されない共通端子21₋₇、とを備 えたリードフレーム21と、上記外部接続端子21_1の所定 域とそれに隣接して位置する電源端子用の外部接続端子 21-2の所定域間に跨がって実装される第1のチップコン デンサ22、該外部接続端子21_1の所定域とそれに隣接す る上記光素子搭載ステージ21-6の所定域間に跨がって実 装される第2のチップコンデンサ23、上記光素子搭載ス テージ21_6に搭載される受光素子12、出力用の外部接続 端子21-4近傍の該リードフレーム21上に搭載されるIC チップ13、該ICチップ13の表面を被覆する光不透過性 樹脂24、および上記受光素子12と各チップコンデンサ2 2,23 とをそれぞれの外部接続端子先端のみが露出する ようにリードフレーム21のデバイス搭載域と共に図10同 様の角形ブロック状に封止する透明樹脂14′とを少なく とも含んで構成されている。

【0022】なお、上記リードフレーム21のシールド片 21-5は例えば上述したデバイス搭載域とほぼ同じ大きさ に形成されているものであり、そのほぼ中央域には図10 で説明した光ファイバ挿入部16a に対応する大きさの孔 21a が形成されている。

【0023】そこで、先ず上記各チップコンデンサ22.2 3 と光素子12および I Cチップ13をリードフレーム21の それぞれの所定位置に導電ペースト等で固定した後、光 素子12の電極を上記共通端子21_っに接続する。

【0024】またICチップ13は、その電源電極を外部 接続端子21-2と、アナログ信号用の接地電極を外部接続 端子21_1と、ディジタル信号用の接地電極を外部接続端 子21-3と、出力電極を外部接続端子21-4と、電源供給電 極を上記光素子搭載板21_6と、更に入力電極を共通端子 21-7とそれぞれ接続する。

【0025】次いで該ICチップ13の表面を光不透過性 樹脂24で被覆する。続いて、光素子12と対応する位置に 図10で説明した光ファイバ挿入部16a と同じ大きさで中 央部に凸の半球レンズ14a を持つ凹み孔14b が形成され るように、外部接続端子領域を除くデバイス搭載域全周 囲を図10同様に透明樹脂14′で封止して角形ブロック状 の透明樹脂体14を形成し、しかる後に該リードフレーム 21の上記シールド片21-5を該透明樹脂体14の表面と接す るように折り込むことで、図示の如き光素子組立体2を 構成することができる。

【0026】かかる光素子組立体2では、受光素子12に

入射する光信号の一部が近接配置されているICチップ 13を照射しても上記光不透過性樹脂24′で遮断されるの で、従来発生していたノイズが抑制できると共に特別な 電磁シールド部材を準備することなく確実な電磁シール ドを得ることができる。

【0027】以下図2~図4で、該光素子組立体2の製 造方法例を工程的に説明する。本発明を実現するリード フレームを示す図2で、外部接続端子21_1, 21_2, 2 1-3, 21-4とシールド片21-5および光索子搭載ステージ2 10 1-6. 共通端子21-7はいずれも図1で説明したものであ り、それぞれの領域は例えばタイパー $t_1 \sim t_9$ によって2 本の帯状材21′に連結されている。

【0028】なお図の破線Bで示す領域が図10の破線A で示す範囲に対応するデバイス搭載域である。そこで、 図1における各チップコンデンサ22,23 と光素子12およ びICチップ13を該リードフレーム21のそれぞれの所定 位置に導電ペースト等で固定し、更に各デバイスと該り ードフレーム21の各端子およびステージ間を図1で説明 したように通常のボンディング技術で接続して図3の(3 20 -1) で示す状態にする。

【0029】次いで (3-2)に示すように I Cチップ13の 表面に例えば 150℃程度で軟化する黒色エポキシ樹脂の 如き光不透過性樹脂24を表面を覆うに足る量だけ滴下す ると、該ICチップ13の表面を (3-3)で示すように該光 不透過性樹脂24でカバーすることができる。

【0030】しかる後、図2におけるデバイス搭載域日 を図10の透明樹脂14′で図1で説明した凹み穴14b を持 つ角形ブロック状に被覆成形して透明樹脂体14を形成す ると、図4の(4-1) で示す状態にすることができる。

【0031】以後、図2の各タイパーt₁~tゅを切断除去 すると共に、各帯状材21′との接続部を切断し、更に上 記シールド片21-5を該透明樹脂体14の表面に沿って折り 込むことで、所要の光素子組立体2を図(4-2) に示すよ うに得ることができる。

【0032】かかる光素子組立体2では、光素子12と対 応する領域に設けた上記凹み穴146とリードフレーム21 のシールド片21_sに設けられた孔21a とが対応している ので、該凹み穴14b に形成されている凸の半球レンズ14 a による集光効果によって光ファイバからの光信号を効 40 率よく電気信号に変換することができる。

【0033】更にリードフレーム21の上記シールド片21 ₋₅がそのまま電磁シールド部材として利用できるので、 特別な電磁シールド部材を準備することなく所要の光素 子組立体を容易且つ安価に構成することができる。

【0034】図5は図2で説明した光素子組立体2にお ける電磁シールド効果を更に高めるために実現させたも のであり、(5-1) は適用させるリードフレームの形状を 示しまた(5-2) は完成時の状態を示したものである。

【0035】すなわち図5の(5-1) でこの場合のリード 50 フレーム31は、上記リードフレーム21のシールド片21-5

7

の領域のみを、上記透明樹脂体14の表面に沿って折り込んだときに該透明樹脂体14の全周囲がカバーし得るような展開図状に拡大したシールド片31-1に置き換えたものであり、その他のパターンは上記シールド片21-sと同様に形成されているものである。

【0036】従って、以下図3~図4で説明した工程を経た後、該シールド片31-1を透明樹脂体14の外面に沿う破線C、D、Eで折り曲げることで、所要の光素子組立体3を図(5-2) に示すように得ることができる。

【0037】かかる光素子組立体3ではデバイス搭載域の全周囲が上記シールド片31-1でカバーされることになるので、特別なシールド部材を準備することなく図1の場合より更に確実な電磁シールドが実現できるメリットがある。

【0038】光素子組立体としての第3の構成例を説明する図6は、表面を絶縁性樹脂で被覆した光素子組立体の構成を示したものである。すなわち図5で説明した光素子組立体3に適用させる場合を例とする図6で、(6-1) は被覆樹脂の形成方法を概略的に例示説明する図であり、(6-2) は完成時の状態を示した図である。

【0039】被覆樹脂形成時の状態を示す図の(6-1)で 被覆樹脂形成用の金型6は、上述した光素子組立体3の 外部接続端子域を除くシールド部本体が僅かな余裕をも って挿入し得るキャピティ61aが形成されている下型61 と該下型61の上面で組み合わされる上型65とで構成され ている。

【0040】そして下型61のキャビティ61aには、光素子12を上面側とした上記光素子組立体3を例えばその外部接続端子域で位置決めして固定し得る等の図示されない手段と、エジェクト機構部62とが設けられている。

【0041】また上型65には、上配下型61に位置決めされた光素子組立体3のシールド片31-1上の孔21aと対応する位置に該孔21に嵌入して透明樹脂体14の表面に接触し得る突起65aと、樹脂注入用のゲート65bとが設けらている。

【0042】そこで、上型65に対して開離した状態にある上記下型61のキャビティ61aに図5で説明した光素子組立体3を光素子12が上面側を向くようにセッティングして位置決めした後上記上型65と該下型51との接触で両者を組み合わせると、外部接続端子域を除くシールド部本体の全周囲に隙間がある図の状態にすることができる

【0043】従って、上型65のゲート65bから被覆用の成形樹脂41′を注入することで、外部接続端子域を除く全周囲が該樹脂41′で被覆された光素子組立体4を図(6-2)に示すように構成することができる。

【0044】かかる光素子組立体4ではリードフレームに繋がるシールド片が表面に露出することがないので、 該シールド片領域に特別な表面処理を施すことなく周囲 雰囲気や環境等によるシールド片としての錆発生や変質 等が抑制できると共に、表面が絶縁樹脂で被覆されているので狭隘部や回路近接部等への装着も自由に行なえる メリットがある。

【0045】なお、かかる光素子組立体4では被覆樹脂41′を透明樹脂に限定する必要がなく如何なる樹脂にも適用し得ることから、樹脂としての価格や成形性、色調等を考慮して樹脂が自由に選択し得るメリットもある。 【0046】光素子組立体としての他の製造方法を示す図7~図9は、図2で説明したリードフレーム21を使用して光素子組立体を構成する場合を例としたものである。すなわち図7の(7-1)は、図3で説明した状態にあるリードフレームを表わしている。

【0047】そこで該リードフレーム21のシールド片21 -5に繋がるタイパー 1_7 、 1_8 を切断除去した後、舌片状になった該シールド片 21_{-5} のデパイス搭載域との連結部を、該シールド片 21_{-5} の孔21a がデパイス搭載域の光素子12と対応するように例えば図示のE、F線でそれぞれ谷折りして(7-2) に示す状態にする。

【0048】次いで、図4で説明した透明樹脂体14の形 20 成方法と同様の樹脂成形技術で透明樹脂体を形成する。 図8の(8-1) はこの場合の樹脂成形時の状態を示した図 である。

【0049】すなわちこのときの樹脂成形用の金型7は、図7の(7-2)における外部接続端子域を除く上記デバイス搭載域がシールド片21₋₅と共に健かな余裕をもって挿入し得るキャピティ71aが形成されている下型71と該下型71の上面で組み合わされる上型75とで構成されている。

【0050】そして下型71のキャピティ71aには、シー30 ルド片21-sひいては光素子12を上側とした上記リードフレーム21を例えばその外部接続端子域で位置決めして固定し得るような図示されない手段と、エジェクト機構部72とが設けられている。

【0051】また、上型75には樹脂注入用のゲート75a が設けられている。そこで、上型75に対して開離した状態にある上記下型71のキャビティ71a に上記リードフレーム21をそのシールド片21₋₅が上側を向くようにセッティングして位置決めした後、上記上型75を該下型71と組み合わせた状態で該上型75のゲート75a から透明樹脂1

40 4'を注入することで、帯状材21'に繋がった外部接続 端子域を除く全周囲が該透明樹脂14'で封止された光素 子組立半完成体5'を図(8-2)に示すように形成するこ とができる。

【0052】従って、以下上記リードフレーム21のタイパーt₁~t₅を切断除去すると共に各外部接続端子21₋₁~21₋₄と帯状材21′との連結部を切断することで、所要の光素子組立体5を図9に示すように得ることができる。【0053】かかる光素子組立体5の製造方法では、図6で説明した光素子組立体4と同様に表面が絶縁性樹脂で覆われた光素子組立体が一回の樹脂成形工程で構成し

得るので、上記光素子組立体4より効率よく構成できる メリットがある。

[0054]

【発明の効果】上述の如く本発明により、光素子組立体 としてのノイズ発生の抑制と確実な電磁シールドとが同 時に効率よく実現できる光素子組立体とその製造方法を 提供することができる。

【0055】なお本発明の説明では光素子が受光素子である場合を例としているが、該光素子をLEDの如き発光素子に代えても同等の効果を得ることができる。また本発明の説明では、リードフレームのシールド片に設ける光素子への光信号入出路を非シールド域とする手段が丸孔である場合を例示しているが、例えば角孔やスリット等の他の手段でも同等の効果が得られることは明らかである。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明になる光素子組立体の構成を概略的に 説明する図。

【図2】 図1に示す実施例の製造工程説明図(その1)。

【図3】 図1に示す実施例の製造工程説明図(その2)。

【図4】 図1に示す実施例の製造工程説明図(その3)。

【図5】 光素子組立体の他の構成例を説明する図。

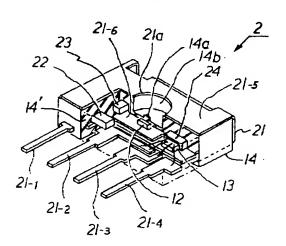
【図6】 光素子組立体の第3の構成例を説明する図。

【図7】 光素子組立体の他の製造方法を工程的に説明 する図(その1)。

【図8】 光素子組立体の他の製造方法を工程的に説明 する図(その2)。

【図1】

本発明になる光素子組立体の構成を振路的に説明する団



【図9】 光素子組立体の他の製造方法を工程的に説明 する図(その3)。

10

【図10】 従来の光素子組立体の構成を製造方法と共に説明する概略図。

【符号の説明】

2,3,4,5 光素子組立体

5′ 光素子組立半完成体

6 金型

12 光素子(受光素子)

13 I C

10 チップ

14 透明樹脂体

14′ 透明

樹脂

14a 凸の半球レンズ

14b 凹み

Æ

21,31 リードフレーム

21′ 帯状

材

21_1~21_4 外部接続端子

21_5 シー

ルド片

21-6 光素子搭載ステージ

21_7 共通

20 端子

21a A

22,23 チップコンデンサ

24 光不

透過性樹脂

31_1 シールド片

41′ 被覆樹脂

61.71 下型

61a,71a

キャビティ

62,72 エジェクト機構部

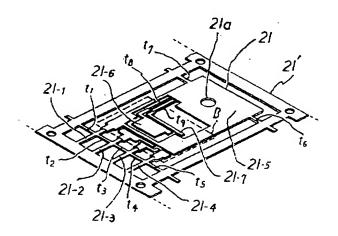
65.75 上型

65a 突起

30 65b,75a ゲート

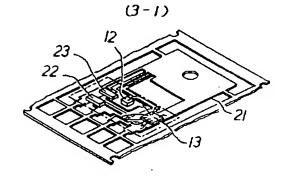
【図2】

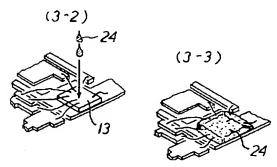
図】に示す実施例の製造工程説明図(その1)



【図3】

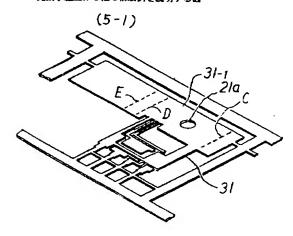
図1に示す実施例の製造工程説明図(その2)

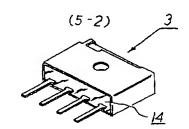




【図5】

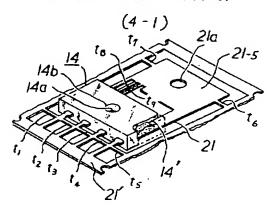
光素子組立体の他の構成例を説明する図

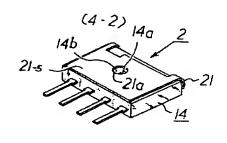




[図4]

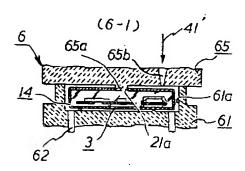
図1に示す実施側の製造工程説明図(その3)

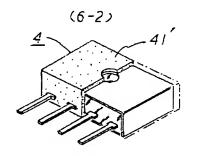




【図6】

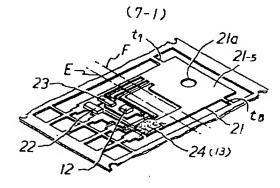
光素子組立体の第 8 の構成例を説明する図

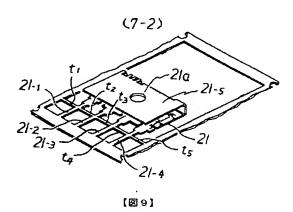




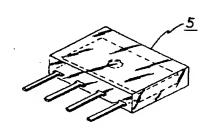
【図7】

光素子組立体の他の製造方法を工程的に説明する図(その 1)



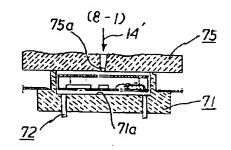


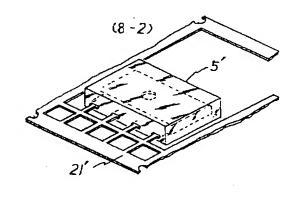
光素子組立体の他の製造方法を工程的に説明する図(その3)



[28]

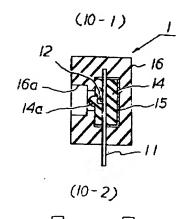
光素子組立体の他の製造方法を工程的に説明する図(その2)

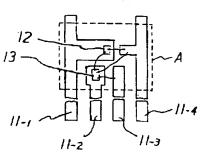




【図10】

従来の光素子組立体の構成を製造方法と共に製明する観略図





フロントページの続き

(51) Int.CI.6

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

(72)発明者 久保 真一

HO1L 31/10

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(72)発明者 二木 和之

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:				
☐ BLACK BORDERS				
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES				
☐ FADED TEXT OR DRAWING				
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING				
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES				
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS				
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS				
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT				
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY				
□ other.				

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.